

بهینه سازی عملکرد لیزر نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP با معرفی ساختار موجبری نامتقارن سه گانه اکستریم

زهرا دانش کفترودی^۱

دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، گروه علوم مهندسی، رودسر، واجارگاه.

دریافت: ۱۳۹۹/۷/۳۰ پذیرش: ۱۴۰۳/۹/۱۰

چکیده

در این مقاله، بهبود عملکرد لیزر نیمه رسانای قرمز مبتنی بر AlGaInP برای اولین بار با معرفی ساختار جدید موجبر نامتقارن سه گانه ی اکستریم بررسی شده است. در ساختار موجبر پیشنهادی جدید برای تغییر ساختار یک لیزر متقارن مرسوم، در گام نخست، ضخامت های لایه ی موجبر و غلاف آلانئید نوع n افزایش یافته است و پس از آن، برای طراحی لایه های غلاف و موجبر آلانئید نوع p و n در ساختار لیزر نیمه رسانای قرمز، یک نامتقارنی سه گانه در نظر گرفته شده است. عملکرد ساختار متقارن مرسوم و ساختار جدید نامتقارن سه گانه ی اکستریم به صورت تئوری در نرم افزار PICS3D انجام شده است. شبیه سازی های سه بعدی انتقال حامل، موجبری نوری و خود گرمایی به صورت خود سازگار در نرم افزار ترکیب شده اند. نتایج شبیه سازی حاکی از بهبود قابل توجه عملکرد ساختار نامتقارن پیشنهادی جدید در مقایسه با ساختار متقارن مرسوم هستند. دلایل بهبود عملکرد لیزر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که استفاده از ساختار جدید منجر به کاهش هم پوشانی مد نوری با نواحی با آلایش بالا می گردد. از طرف دیگر با کاهش جریان نشتی الکترون ها، افزایش در آهنگ باز ترکیب القایی رخ می دهد که این منجر به کاهش جریان آستانه، افزایش توان خروجی می گردد. با کاهش مقاومت سری و افزایش پایداری حرارتی ساختار پیشنهادی جدید، بهینگی این ساختار تایید می گردد.

واژه های کلیدی: لیزر دیود مبتنی بر AlGaInP، شبیه سازی، توان، جریان آستانه، موجبر نامتقارن سه گانه ی اکستریم، PICS3D.

^۱ نویسنده مسئول zahraadanesh@guilan.ac.ir

۱- مقدمه

لیزرهای نیمه رسانا یکی از ادوات کارآمد در تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی نوری هستند و به همین دلیل در فن-آوریهای پیشرفته نوری، از عناصر اصلی محسوب می‌شوند [۱]. در این بین، لیزرهای نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP با طول موج خروجی ۶۶۰ نانومتر افزاره‌های کلیدی برای استفاده به عنوان منابع نوری در سیستم‌های اپتیکی کاربردی برای دیسک‌های چندکاره‌ی دیجیتالی قابل ضبط و قابل نوشتن هستند. در این سیستم‌ها ضبط با سرعت بالا مورد نیاز است، بنابراین، توان نوری پرتوی لیزری که بر روی دیسک متمرکز می‌شود برای تامین این نیاز، باید افزایش یابد. برای دستیابی به این امر، لیزرهای نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP با کارایی بالا مورد نیاز هستند [۲].

لیزرهای نیمه رسانا معمولاً از کاواک نوری^۱ بزرگ با ساختارهای محدودکننده‌ی مجزایی^۲ استفاده می‌کنند که از موجبرهای متقارن تشکیل می‌شوند. این موجبرهای پهن متقارن توسط لایه‌های غلاف^۳ با آلایدگی p و n با ترکیب مادی نیمه رسانای مشابه در لایه‌های مذکور ساخته می‌شوند. در لیزرهای توان بالا که بسیار بالاتر از سطح آستانه کار می‌کنند، مشخصه‌ی بسیار مهم عملکرد لیزر، کارایی بالای آن در جریان‌های تزریقی پایین است. اما، در جریان تزریقی بسیار بالا، به دلیل گرمایش لیزر در موجبرهای پهن، کاهش توان رخ میدهد [۳]. طراحی موجبر متقارن بسته به کاربرد مورد نظر لیزر قابل بهینه‌سازی است. یک رویکرد برای حل این مساله که به صورت تجربی توسط بودا^۴ برای لیزرهای نیمه رسانا با طول موج خروجی ۸۲۶ nm انجام شده است، شامل تغییر تقارن موجبر در لیزر مذکور می‌شود. در ساختار موجبر پیشنهادی او، همپوشانی مد نوری با لایه غلاف با آلایش نوع p که دارای جذب نوری بسیار بالاست، کاهش یافته است [۴]. در سال‌های اخیر، به طور موفقیت‌آمیزی از ساختارهای موجبری نامقارن دوگانه‌ی اکستریم (EDAS)^۵ برای لیزرهای توان بالا با چاه‌های کوانتومی InGaAs در طول موج ۹۴۰ nm استفاده شده است [۵ و ۶]. در ساختارهای EDAS، ضخامت لایه‌ی غلاف با آلایش نوع n افزایش داده می‌شود. علاوه بر این، اختلاف ضریب شکست موجود بین لایه‌های موجبر و غلاف نوع n بسیار کمتر از این اختلاف در لایه‌های غلاف و موجبر نوع p است. ضخامت لایه‌ی غلاف نوع p نیز کاهش داده می‌شود، تا با کاهش اتلاف نوری ناشی از جذب، کارایی لیزر نیمه رسانا افزایش چشمگیری یابد. علاوه بر این با کاهش ضخامت لایه غلاف نوع p مقاومت الکتریکی لیزر تا حد زیادی کاهش می‌یابد که منجر به بهبود عملکرد لیزر می‌شود. اما، این امر موجب افزایش جریان آستانه به

¹ Optical Cavity

² Separate Confinement

³ Cladding layer

⁴ Buda

⁵ Extreme Double Asymmetric

دلیل کاهش شدید همپوشانی مد نوری با ناحیه‌ی فعال (کاهش بهره نوری) می‌گردد. این تحقیقات بر روی موجبرهای نامتقارن حاکی از اهمیت بهینه‌سازی طراحی موجبر برای بهبود عملکرد لیزر است. روش پیشنهادی جدید در این مقاله برای کاهش جریان آستانه عبارت است از ساختار نامتقارن سه‌گانه‌ی اکستریم (ETAS)^۱. در این ساختار نامتقارن، در گام نخست، طول لایه‌ی غلاف نوع n افزایش داده می‌شود و نامتقارنی سه‌گانه بر روی طراحی لایه‌های نیمه رسانای استفاده شده در ساختار جدید معرفی می‌گردد [۷].

یافتن بهترین و کارآمدترین ساختارها برای لیزرهای نیمه رسانا کاری نیست که بتواند به راحتی و تنها بصورت تجربی صورت گیرد. مدل‌سازی محاسباتی اخیرا به عنوان رویکردی مقرون به صرفه در راستای طراحی لیزرهای نیمه رسانای جدید و همچنین پیش‌بینی مشخصات آن‌ها به کار برده می‌شود. [۸].

در این مطالعه، دو لیزر نیمه رسانای مبتنی بر AlGaInP بررسی شده اند تا توان خروجی لیزر با جریان آستانه و ولتاژ کار قابل قبولی ایجاد شود. اول، لیزر چاه کوانتومی متقارن مرسوم پیشنهاد شده و با استفاده از PICS3D^۲ شبیه‌سازی شده است. این نرم افزار یک شبیه‌ساز سه بعدی برای طراحی لیزرهای نیمه رسانا و سایر ادوات فوتونیکی با ناحیه فعال است [۹]. این شبیه ساز به طور خودسازگار^۳ شبیه‌سازی سه بعدی انتقال حامل، موجبری نوری و خودگرمایش را با یکدیگر ترکیب می‌کند. در ادامه، نشان داده شده است که لیزر نیمه رسانا با ساختار جدید نامتقارن سه‌گانه‌ی اکستریم با خصوصیات بهبود یافته دارای جریان آستانه و مقاومت سری کاهش یافته، توان خروجی و بازده شیب افزایش یافته و پایداری حرارتی بهبود یافته است. در ساختار موجبر پیشنهادی جدید، ابتدا، ضخامت لایه‌های موجبر و غلاف نوع n افزایش داده شده است و پس از آن، نامتقارنی سه‌گانه در طراحی لایه‌های غلاف و موجبر نوع n و نوع p در ساختار لیزر نیمه رسانا در نظر گرفته شده است. ساختار این مقاله به شرح زیر است. در بخش‌های دوم و سوم، به ترتیب، ساختار لیزر، مدل‌های نظری و پارامترهای مادی بکار رفته در این تحقیق معرفی شده اند. بخش چهارم به ارائه نتایج شبیه‌سازی و بحث اختصاص داده شده است.

۲- ساختار لیزر

لیزر متقارن از لایه‌ی بافر^۴ n-Al_{0.7}Ga_{0.3}As با ضخامت ۰.۳ μm، لایه‌ی غلاف n-(Al_{0.5}Ga_{0.5})_{0.5}In_{0.5}P با ضخامت ۲ μm، لایه‌ی موجبر n-(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}P با ضخامت ۱ μm تشکیل شده است. ناحیه فعال شامل سه چاه کوانتومی کرنش یافته In_{0.55}Ga_{0.45}P با ضخامت ۰.۰۰۵ μm و سدهای (Al_{0.5}Ga_{0.5})_{0.5}In_{0.5}P با ضخامت ۱ μm می‌شود. لایه‌ی موجبر p-(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.5}In_{0.5}P با ضخامت ۱ μm، لایه‌ی غلاف p-(Al_{0.5}Ga_{0.5})_{0.5}In_{0.5}P با ضخامت ۲ μm و لایه‌ی پوشش^۵ p-Al_{0.7}Ga_{0.3}As با آلایش بالا و ضخامت ۰.۱ μm در ساختار قرار داده شده اند. طول

^۱ Extreme Triple Asymmetric Structure

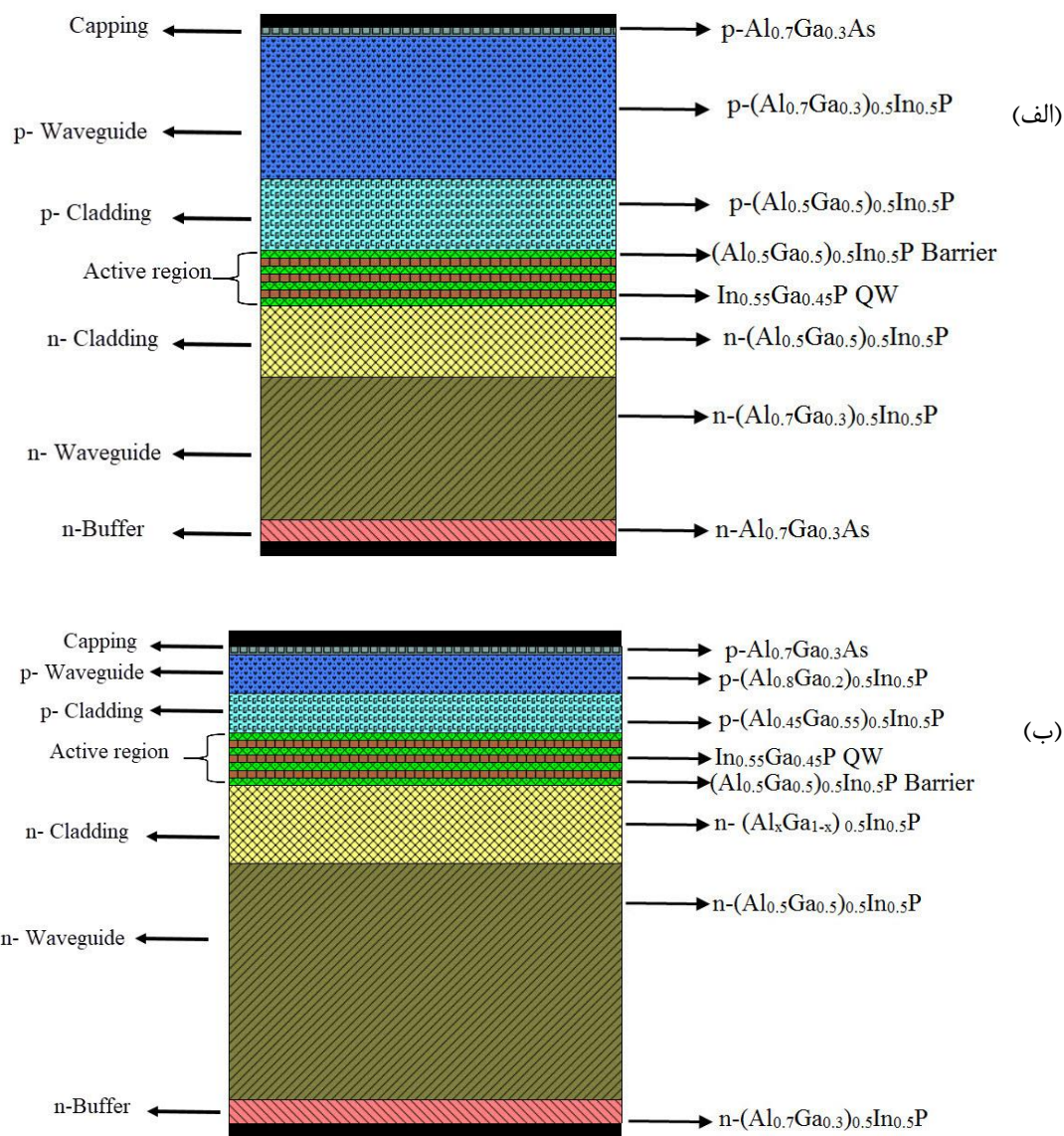
^۲ Photonic Integrated Circuit Simulator in 3D

^۳ Self-Consistent

^۴ Buffer

^۵ Capping

کاوک فابری - پرو^۱ برابر با $400 \mu\text{m}$ در نظر گرفته شده است. هر دو رخ لیزر دارای انعکاس 52% هستند. در ساختار نامتقارن سه گانه‌ی اکستریم، ضخامت لایه‌های غلاف $p\text{-(Al}_{0.8}\text{Ga}_{0.2})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ ، موجبر و غلاف $n\text{-(Al}_{0.5}\text{Ga}_{0.5})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ به ترتیب برابر با $0.5 \mu\text{m}$ ، $0.5 \mu\text{m}$ و $3 \mu\text{m}$ هستند. ترکیب لایه‌ی موجبر $n\text{-(Al}_x\text{Ga}_{1-x})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ دارای گریدینگ خطی^۲ از $x = 0.5$ تا $x = 0.7$ بر روی ضخامت $1 \mu\text{m}$ است. بخش‌های دیگر ساختار لیزر متقارن در لیزر پیشنهادی نامتقارن جدید بدون تغییر باقی مانده است. شکل ۱ ساختارهای متقارن و ETAS را نشان می‌دهد.



شکل ۱. ساختار شماتیک (الف) لیزر با موجبر متقارن و (ب) لیزر با موجبر ETAS

¹ Fabry-Perot

² Linear Graded

۳- مدل تئوری و پارامترهای مادی

از شبیه‌ساز PICS3D برای تحلیل، طراحی و بهینه‌سازی ساختارهای پیشنهادی استفاده می‌شود. معادلات اصلی که رفتار الکتریکی نیمه هادی را توصیف می‌کنند رابطه‌ی پواسون^۱ (۱) همراه با معادلات پیوستگی جریان^۲ (۲) و (۳) برای الکترون‌ها و حفره هستند [۱۰]:

$$-\nabla \cdot \left(\frac{\epsilon_0 \epsilon_{dc}}{q} \nabla V \right) = -n + p + N_D(1-f_D) - N_A + \sum_j N_t(\delta_j - f_{tj}) \quad (۱)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_n - \sum_j R_n^{tj} - R_{sp} - R_{st} - R_{Aug} + G_{opt}(t) = \frac{\partial n}{\partial t} + N_D \frac{\partial f_D}{\partial t} \quad (۲)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{J}_p + \sum_j R_p^{tj} + R_{sp} + R_{st} + R_{Aug} - G_{opt}(t) = -\frac{\partial p}{\partial t} + N_A \frac{\partial f_A}{\partial t} \quad (۳)$$

در رابطه‌ی (۱) ϵ_0 و ϵ_{dc} به ترتیب ضریب گذردهی مربوط به خلا و دی‌الکتریک هستند. همچنین، n و p تراکم الکترون‌ها و حفره‌ها هستند. N_D و N_A چگالی ناخالصی‌های سطحی دهنده و گیرنده هستند. N_{tj} چگالی j امین تله عمیق است، f_D و f_A به ترتیب ترازهای فرمی ناخالصی‌های دهنده و گیرنده هستند و f_{tj} تراز فرمی j امین تله‌ی عمیق است. در روابط (۲) و (۳)، G_{opt} آهنگ تولید فوتون در واحد حجم است. همچنین، R_{sp} ، R_{st} و R_{Aug} به ترتیب آهنگ بازترکیبهای القایی^۳، خودبخودی^۴ و اوزه^۵ هستند [۱۰]. برای در نظر گرفتن ویژگی‌های نوری لیزر نیمه‌هادی یعنی توزیع میدان نوری و تعداد فوتون‌ها در کاواک لیزر، معادله‌ی موج اسکالر مختلط و معادله‌ی آهنگ تغییرات فوتون حل می‌شوند. بهره‌ی نوری بر مبنای مدل گذار بین نواری^۶ محاسبه می‌شود [۱۱]:

$$g(E) = \frac{g_0}{2\pi Et} \sum_{i,j} \int_0^\infty \frac{\left(\frac{\pi}{\Gamma}\right) f_{dip}(k_t) M_b(f_j - f_i) d^2 k_t}{1 + \frac{(E_{cj}(k_t) - E_{kpi} - E)^2}{\Gamma^2}} \quad (۴)$$

که t ضخامت چاه کوانتومی و $\Gamma = \hbar / \tau_{scat}$ پهن شدگی ناشی از زمان واهلش پراکندگی بین نواری است. E_{cj} نشان دهنده j امین زیر نوار باند هدایت است و E_{kpi} نیز i امین زیرنوار باند ظرفیت در محاسبه‌ی k, p است. جمع بندی بر روی زیرنوارهای هدایت و ظرفیت است. $g_0 = \pi q^2 \hbar / \epsilon_0 c m_0^2 n$ ثابتی با تمام نمادهایی هست که دارای معانی معمول خود هستند. M_b ممان دو قطبی نام دارد [۱۱]. کار بر روی چاه‌های کوانتومی کرنش یافته^۷ با استفاده

^۱ Poisson's Equation

^۲ Current Continuity

^۳ Stimulated Recombination

^۴ Spontaneous Recombination

^۵ Auger Recombination

^۶ Interband Transition

^۷ Strained Quantum Well

از نظریه ی $k.p$ انجام می شود، اثرات آمیختگی نوار ظرفیت^۱ در نظر گرفته شده است و زیرنوارهای چاه کوانتومی برای محاسبه ی غلظت های حامل و بهره ی نوری با قطری سازی هامیلتونین لوتینگر- کون^۲ در تقریب چهار نوری حل می- شوند [۱۲]:

$$\begin{pmatrix} P+Q & -S & R & 0 \\ -S^* & P-Q & 0 & R \\ R^* & 0 & P-Q & S \\ 0 & R^* & S^* & P+Q \end{pmatrix} \quad (5)$$

با

$$\begin{aligned} P &= \frac{\hbar^2}{2m_0} \gamma_1 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) + P_\varepsilon + E_0(z), \\ Q &= \frac{\hbar^2}{2m_0} \gamma_2 (k_x^2 + k_y^2 - 2k_z^2) + Q_\varepsilon, \\ S &= \sqrt{3} \frac{\hbar^2}{m_0} \gamma_3 k_z (k_x - ik_y), \\ R &= \sqrt{3} \frac{\hbar^2}{2m_0} (\gamma_2 (k_x^2 - k_y^2) - 2\gamma_3 k_x k_y), \end{aligned} \quad (6)$$

$$P_\varepsilon = -a_v (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}),$$

$$Q_\varepsilon = -\frac{b}{2} (\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} - 2\varepsilon_{zz}),$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{a_{st} - a_0}{a_0},$$

$$\varepsilon_{zz} = -2 \frac{C_{12}}{C_{11}} \varepsilon_{xx},$$

که $\hbar$ ثابت پلانک است که بر 2π تقسیم می شود و m_0 جرم آزاد الکترون است، γ_1 ، γ_2 و γ_3 به ترتیب پارامترهای لاتینگر^۳ هستند و k_x ، k_y و k_z به ترتیب مولفه های بردار موج هستند، $E_v(z)$ پتانسیل محدودسازی^۴ در نوار ظرفیت است، ε_{ij} عبارت است از مولفه های تانسور کرنش^۵، a_v و b پتانسیل های تغییر شکل^۶ هستند، C_{ij} ثابت های الاستیک

¹ Valence Band Mixing

² Luttinger_Kohn Hamiltonian

³ Luttinger

⁴ Confinement Potential

⁵ Strain Tensor

⁶ Deformation Potentials

هستند، a_0 و a_{st} ثابت‌های شبکه به ترتیب برای ساختارهای غیر کرنشی و کرنش یافته هستند. R^* و S^* به ترتیب مزدوج هرمیتی R_k و S_k هستند و با تغییر علامت بخش موهمومی i حاصل می‌شوند.

در مدل حرارتی، از نقطه نظر تئوری، مساله‌ی ما شامل حل معادله‌ی شارش حرارتی است [۱۲]:

$$C_L \rho_L \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot K_L \nabla T + H_{heat} \quad (7)$$

که C_L حرارت ویژه‌ی شبکه بلوری و H_{heat} منابع تولید گرما هستند. ρ_L و K_L به ترتیب چگالی ماده و هدایت گرمایی را نشان می‌دهند. می‌توان منابع گرمایش را به گرمای ژول^۱، گرمای تولید و بازترکیب^۲، گرمای جذب^۳ و گرمای تامسون^۴ تقسیم کرد [۱۲].

اکثر پارامترهایی که در شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند، مقادیر استاندارد حاصل از مرجع [۱۲] هستند. ضرایب بازترکیب خودبخودی و اوزه به ترتیب برابر هستند با $B = 2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ و $C_n = C_p = 2 \times 10^{-43} \text{ cm}^6 \text{ s}^{-1}$ و $\alpha_p = 12 \times 10^{-18} \text{ cm}^2$ و $\alpha_n = 4 \times 10^{-18} \text{ cm}^2$ هستند. چگالی‌های موثر حالت‌های چاه‌های کوانتومی از روی محاسبه‌ی کوانتوم-مکانیکی حاصل می‌شوند. در شبیه‌سازی حرارتی، فرض بر این است که اتصال پایینی دارای دمای شبکه و اتصال بالایی دارای جریان توان حرارتی پیش‌رونده باشد. ضریب انتقال حرارت در اتصال p -برابر با صفر است. دمای شبکه مجهول است که با حل معادله‌ی شارش حرارتی به دست می‌آید. ضرایب رسانش گرمایی بصورت تقریبی با در نظر گرفتن اثرات ترکیب آلیاژ و پراکنش رابطه‌ی فونون بر روی رسانش حرارتی تخمین زده می‌شوند. K_L برای لایه‌های نیمه رسانای $(\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ و $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{AS}$ به ترتیب 6 W/Kcm و 15 W/Kcm در نظر گرفته شده است [۱۳].

موبیلیتی^۵ حامل یک پارامتر مادی کلیدی در شبیه‌سازی انتقال حامل‌ها است. از تقریب توماس^۶ برای تخمین موبیلیتی به عنوان تابعی از چگالی حامل استفاده شده است [۱۲]:

$$\mu(N) = \mu_{min} + \frac{\mu_{max} - \mu_{min}}{1 + \left(\frac{N}{N_{ref}}\right)^\alpha} \quad (8)$$

که μ_{max} بیشینه موبیلیتی (بدون ناخالصی) و μ_{min} کمینه موبیلیتی برای چگالی‌های ناخالصی بالا است. پارامترهای موبیلیتی برای $(\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ و $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{AS}$ به ترتیب در جدول ۱ و ۲ نشان داده شده‌اند.

¹ Joule Heat

² Generation / Recombination Heat

³ Absorption Heat

Heat⁴ Thomson

⁵ Mobility

⁶ Thomas Approximation

جدول ۱. پارامترهای موبیلیتی $(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$

پارامتر	μ_{min}	μ_{max}	N_{ref}	α
واحد	$m^{-2}V^{-1}s^{-1}$	$m^{-2}V^{-1}s^{-1}$	m^{-3}	-
الکترون‌ها	۰	۰,۰۱۵	5×10^{23}	۰,۴۳
حفره‌ها	۰	۰,۰۳۹۷	$2,7 \times 10^{23}$	۰,۳۹۷

 جدول ۲. پارامترهای موبیلیتی $Al_xGa_{1-x}As$

پارامتر	μ_{min}	μ_{max}	N_{ref}	α
واحد	$m^{-2}V^{-1}s^{-1}$	$m^{-2}V^{-1}s^{-1}$	m^{-3}	-
الکترون‌ها	۰	۰,۸۵	$1,69 \times 10^{23}$	۰,۴۳۶
حفره‌ها	۰	۰,۴	$2,75 \times 10^{23}$	۰,۳۹۵

برای سیستم ماده‌ی $(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$ ، پهنای گاف نواری با استفاده از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود [۱۳]:

$$E_g((Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}) = 4.07 + 0.5 \times (1.425 - (1.9 + 0.6x)) \quad (9)$$

و برای $Al_xGa_{1-x}As$:

$$E_g(Al_xGa_{1-x}As) = 1.9 + 0.125x + 0.143x^2 \quad (10)$$

ضریب شکست $(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$ برای لایه‌های مختلف در لیزر با استفاده از روابط زیر محاسبه می‌شود [۱۲]:

$$n_r = 3.65 - 0.37x \quad (11)$$

و برای لایه‌های $Al_xGa_{1-x}As$:

$$n_r = 3.65 - 0.73x \quad (12)$$

در این تحقیق، پارامترهای مربوطه برای محاسبه بهره نوری و ساختار نواری سیستم‌های مادی $(\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x})_{0.5}\text{In}_{0.5}\text{P}$ و $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ از درون‌یابی خطی^۱ مقادیر ترکیبات نیمه رسانای دوتایی به دست آمده اند. پارامترهای مادی ترکیبات نیمه رسانای دوتایی بر در جدول ۳ ارائه شده‌اند.

جدول ۳. پارامتر ماده نیمه‌هادی دوتایی بکار رفته در این تحقیق

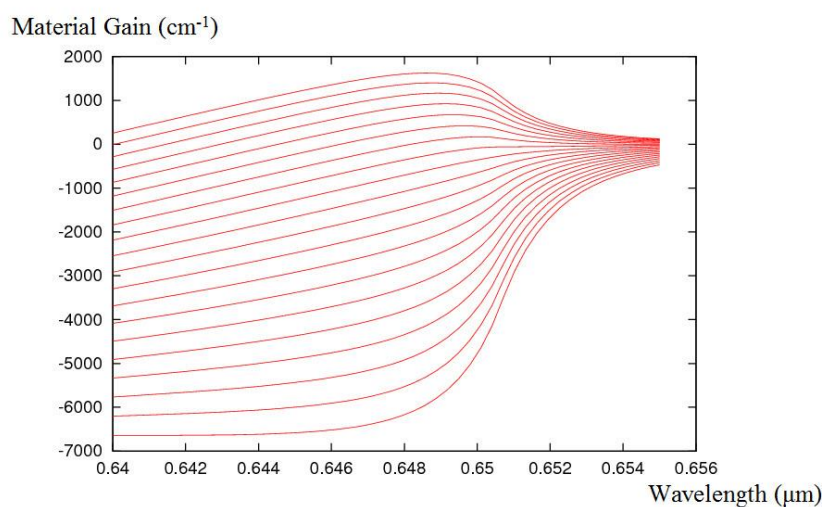
پارامتر	واحد	GaAs	InAs	AlAs	InP
m_c	m_0	۰,۰۶۶۵	۰,۰۲۷	۰,۱۵	۰,۰۶۴
γ_1	-	۶,۸۵	۱۹,۶۷	۳,۷۵	۶,۳۵
γ_2	-	۲,۱	۸,۳۷	۰,۸۲	۲,۰۸
γ_3	-	۲,۹	۹,۲۹	۱,۴۲	۲,۷۶
a_0	Å	۵,۶۵۳۲۵	۶,۰۵۸	۵,۶۶۱۱	۵,۸۶۹
C_{11}	GPa	۱۱۸۱	۸۳۲۹	۱۲۵۰	۱۰۲۲
C_{12}	GPa	۵۳۲	۴۵۲,۶	۵۴۳	۵۷۹
a_v	eV	۱,۱۶	۱	۲,۴۷	۰,۶
B	eV	-۲	-۱,۸	-۲,۳	-۲

۴- نتایج شبیه‌سازی و بحث

برای حصول اطمینان از اینکه ترکیب و ضخامت چاه‌های کوانتومی برای تولید طول موج مطلوب مناسب هستند، ابتدا بهره نوری بررسی می‌شود. محاسبه‌ی بهره با استفاده از PICS3D در شکل ۲ ارائه شده است. غلظت حامل‌های موجود در چاه‌های کوانتومی برای محاسبه‌ی بهره‌ی نوری به ترتیب برای پایین‌ترین و بالاترین منحنی در باز m^{-3} 5×10^{23} تا $5 \times 10^{24} m^{-3}$ قرار دارد. باید خاطر نشان شود که با انتخاب درست پارامترهای مادی بکار رفته در شبیه‌سازی‌ها، می‌توان طول موج لیزر دهی افزاره‌های پیشنهاد شده را با دقت چندین نانومتر پیش‌بینی کرد. شکل ۲ تایید می‌کند که به دلیل بهره‌ی مثبت چاه‌های کوانتومی در لیزرهای پیشنهاد شده در بازه‌ی طول موج بین $0,64 \mu m$ تا $0,655 \mu m$ ، این ادوات در محدوده طول موجی ذکر شده فعالیت می‌کنند. به همین دلیل، ترکیب و ضخامت چاه

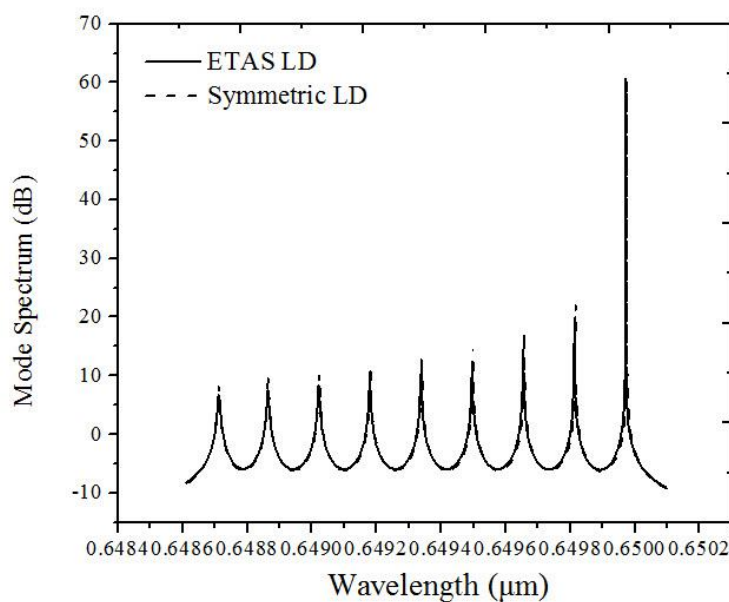
¹ Linearly Interpolated

های کوانتومی برای فعالیت در طول موج قرمز مناسب هستند. بیشینه بهره‌ی به و محدوده‌ی طول موج به دست آمده از این نمودار تطابق مناسبی با مرجع [۱۴] دارد.



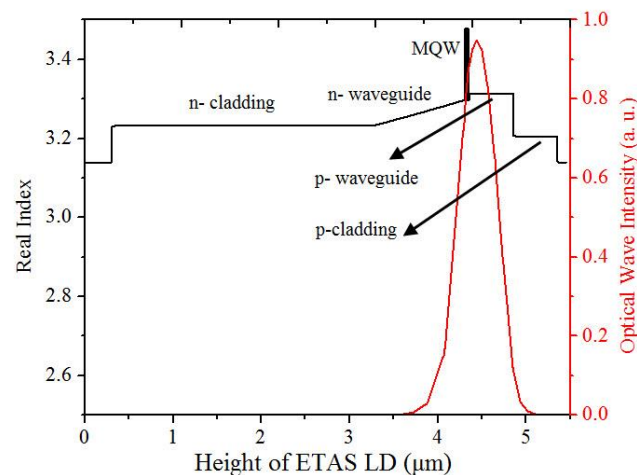
شکل ۲. بهره محاسبه شده چاه های کوانتومی

با توجه به مراجع مختلف و نمونه های تجاری موجود، طیف های مدی مربوط به دو ساختار پیشنهادی در جریان تزریقی ۲۰۰ mA و دمای زمینه ۲۰°C در شکل ۳ نشان داده شده اند. این شکل فعالیت لیزرهای ETAS و متقارن را در طول موج ۶۵۰،۰ μm اثبات می کند. این بدان معناست که موجبر ETAS پیشنهادی طول موج خروجی لیزر را تغییر نمی دهد.



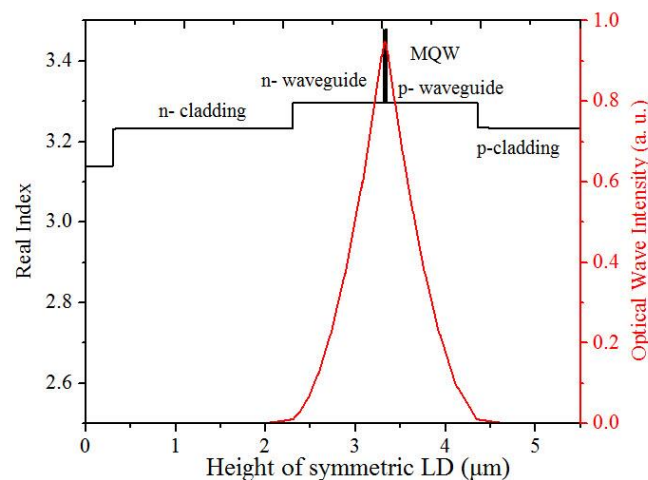
شکل ۳. طیف های مد لیزر متقارن و لیزر ETAS در ۲۰۰ mA و دمای زمینه ۲۰°C

نمودارهای ضریب شکست و شدت نوری محاسبه شده‌ی مد اصلی به ترتیب در شکل‌های ۴ و ۵ برای لیزر دیودهای ETAS و متقارن نشان داده شده‌اند. بیشینه شدت موج نوری در طرح موجبر متقارن دقیقاً در محل چاه‌های کوانتومی قرار گرفته است و این در حالی است که بیشینه شدت ETAS به طرف سمت p جابجا شده است. این بدان معناست که ضریب محدودیت نوری^۱ طرح جدید کاهش می‌یابد. لذا، انتظار می‌رود که عملکرد لیزر دیود^۲ (LD) تخریب شود. در لیزرهای نیمه رسانا محدود سازی مد نوری در ساختار موجبر توسط اختلاف ضریب شکست بین لایه‌های غلاف و موجبر تعیین می‌شود. هرچه قدر اختلاف بین ضرایب شکست کوچک‌تر باشد، مد با قدرت بیشتری در لایه‌های غلاف نفوذ می‌کند.



شکل ۴. نمودار ضریب شکست و مد نوری در لیزر دیود ETAS

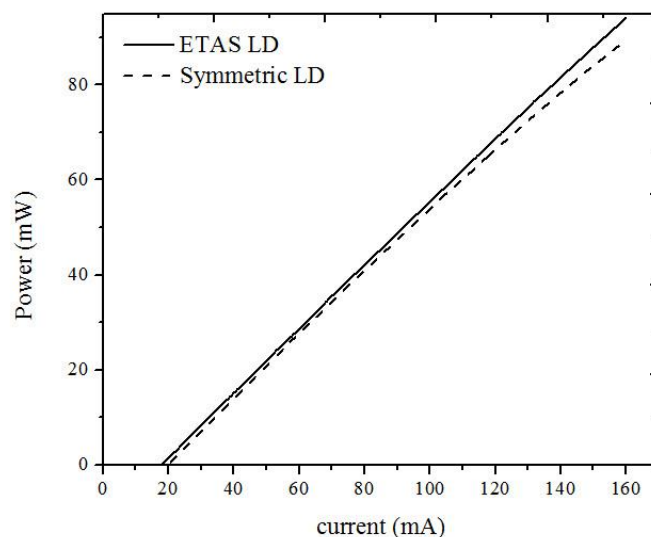
همانطور که در شکل ۵ نشان داده شده است، به‌خاطر اختلاف ضریب شکست کوچک‌تر بین لایه‌های پوشش و موجبر نوع n و نوع p، نفوذ مد نوری در لایه‌هایی با ناخالصی بالا و در نتیجه اتلاف نوری منتهی در لیزر دیود متقارن افزایش می‌یابد. افزایش اتلاف نوری موجب افزایش جریان آستانه و کاهش توان خروجی لیزر دیود متقارن می‌شود. نمودارهای نمایش داده شده در شکل‌های ۴ و ۵ همخوانی مناسبی با نمودارهای مشابه در مرجع [۱۵] دارند.



شکل ۵. ضریب شکست و مد نوری در لیزر دیود متقارن

^۱ Optical Confinement Factor

شکل ۶ این ایده را تایید می‌کند. مشخصه‌ی توان-جریان شبیه‌سازی شده برای لیزر دیود^۱های با ساختار موجبر ETDAS و ساختار متقارن در دمای زمینه 20°C در شکل ۶ مقایسه شده است. جریان‌های آستانه برای لیزرهای موجبر ETDAS و متقارن به ترتیب برابر با 17.7 mA و 20 mA هستند. یعنی جریان آستانه تقریباً 2 mA کاهش می‌یابد. توان خروجی از 89.9 mW برای لیزر دیود متقارن به 94.7 mW برای لیزر دیود ETDAS در 200 mA افزایش می‌یابد.



شکل ۶. مشخصه‌ی توان - جریان شبیه‌سازی شده برای ساختارهای متقارن و ETDAS در دمای زمینه 20°C

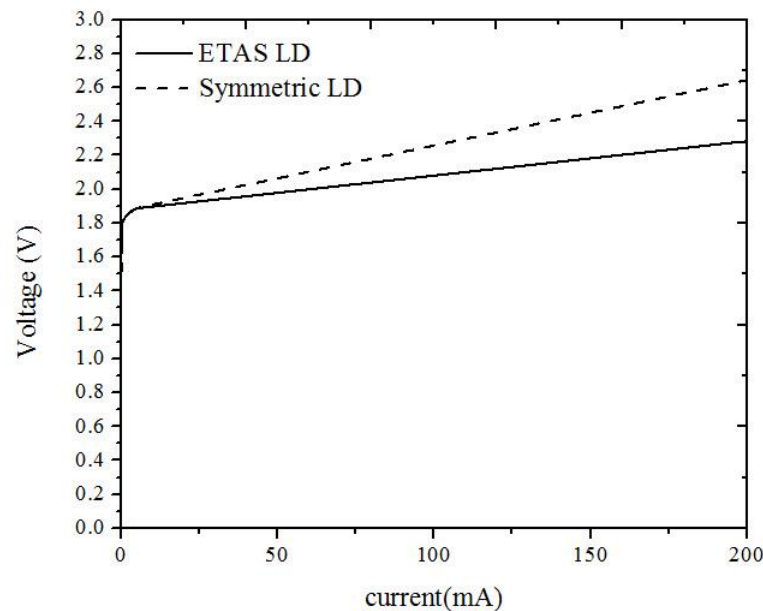
بازده شیب^۲ ویژگی مهم لیزرهای نیمه رسانا است. این ویژگی درصد الکترون‌های تزریقی بالاتر از آستانه‌ای را نشان می‌دهد که در تولید فوتون برای ایجاد پرتوی لیزر شرکت می‌کنند [۱۲]. این ویژگی با رسم توان خروجی دیود لیزری به ازای جریان تزریقی حاصل می‌شود. بالاتر از جریان آستانه، همانطور که در شکل ۶ نشان داده شده است، منحنی نتیجه معمولاً نزدیک به خط صاف است. بازده شیب برابر با شیب این خط است. بازده شیب نیز محاسبه می‌شود که از 0.62 W/A برای لیزر دیود متقارن به 0.65 W/A برای لیزر دیود ETAS افزایش یافته است و این یک بهینگی برای هر لیزری محسوب می‌شود. نمودار توان - جریان به دست آمده در این شبیه سازی توسط مطالعات تجربی مراجع [۱۵ و ۱۶] قابل تایید است.

شکل ۷ ولتاژ لیزر دیودهای متقارن و ETDAS را به ازای جریان تزریقی نشان می‌دهد. در رابطه با منحنی‌های ولتاژ-جریان، ولتاژ آستانه لیزر دیود ETDAS کمتر از لیزر دیود متقارن است. ولتاژهای آستانه به ترتیب برای لیزر دیود متقارن و لیزر دیود ETDAS برابر با 1.99 V و 1.95 V هستند. همچنین می‌توان مقاومت سری را از روی

¹ Laser Diode

^۲ Slope Efficiency

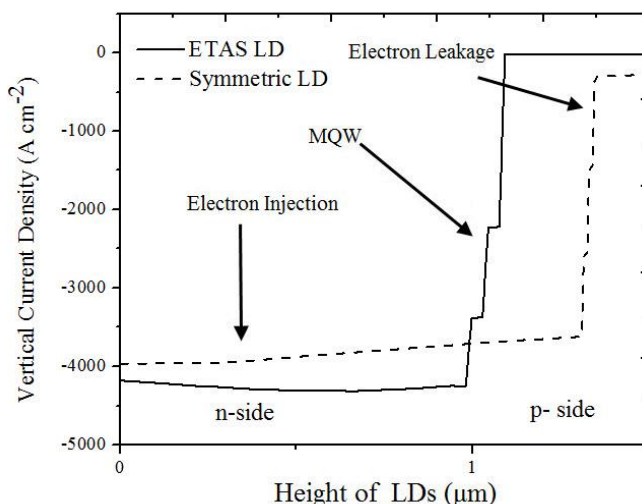
شیب منحنی‌های ولتاژ-جریان محاسبه کرد که این مقاومت از 24.7Ω برای لیزر دیود متقارن به 3.8Ω برای لیزر دیود ETDAS کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، مقاومت سری لیزر دیود ETDAS به اندازه‌ی 21.1Ω کمتر از لیزر دیود متقارن است. این بدان معناست که عملکرد لیزر دیود ETDAS تا حد زیادی بهبود می‌یابد.



شکل ۷. نمودارهای ولتاژ-جریان شبیه‌سازی شده برای ساختارهای متقارن و ETDAS در دمای زمینه 20°C

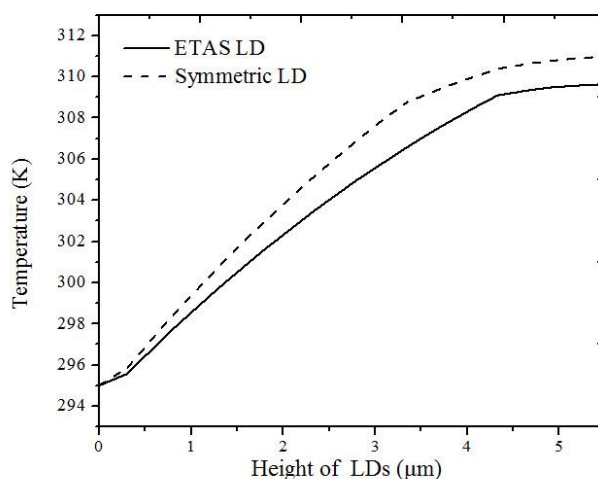
دلیل افزایش توان خروجی لیزر دیود ETDAS از روی شکل ۸ قابل درک است. توزیع عمودی چگالی جریان الکترون در ساختار متقارن و ETDAS در 200 mA در این شکل نشان داده شده است. در لیزرهای نیمه رسانا، الکترون‌هایی که توسط چاه محدود نشده‌اند احتمالاً به ناحیه‌ی نوع p نشت کرده و جریان نشتی الکترون^۱ را شکل خواهند داد. هرگاه الکترون‌ها از لایه‌های سمت n به چاه‌های کوانتومی تزریق شوند، با حفره‌های موجود در آنجا بازترکیب شده و چگالی جریان الکترون در هر چاه کوانتومی کاهش پیدا می‌کند [۱۷]. همانطور که در شکل ۸ مشخص است، چگالی جریان الکترون در ساختار ETDAS بزرگ‌تر از ساختار متقارن در چاه‌های کوانتومی در سمت n لیزر است و این بدان معناست که الکترون‌های بیش‌تری با حفره‌ها در چاه‌های کوانتومی در ساختار ETDAS در مقایسه با لیزر دیود متقارن بازترکیب می‌شوند. به‌خاطر بازترکیب موثرتر الکترون‌ها و حفره‌ها در ناحیه‌ی فعال لیزر ETDAS، بازترکیب القایی ساختار نامتقارن افزایش می‌یابد. افزایش بازترکیب القایی به این معنی است که الکترون‌ها و حفره‌های بیش‌تری در تولید فوتون شرکت خواهند کرد و بدین ترتیب توان خروجی نیز افزایش پیدا می‌کند.

¹ Electron Leakage Current



شکل ۸. چگالی جریان الکترون شبیه سازی شده بر حسب ارتفاع برای ساختارهای متقارن و ETAS در جریان تزریقی ۲۰۰mA و دمای زمینه ۲۰°C

پارامتر مهم دیگر در عملکرد دیودهای لیزر توان بالا عبارت است از بهینه سازی ویژگی های حرارتی لیزر. به طور خاص، بهینه سازی هندسه ی لیزر برای دستیابی به عملکرد توان بالا معیار مهمی در طراحی آن است. دماهای مربوط به ساختارهای متقارن و نامتقارن بر حسب ارتفاع افزاره هادر شکل ۹ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، دمای ساختار ETAS تقریباً تا ۱۴ K افزایش می یابد که کمتر از نوع متقارن در همان جریان است. این امر به خاطر پایین بودن مقدار جذب نوری و برداشت گرمایی موثر تر در ساختار نامتقارن است. دلیل اصلی برای جذب نوری پایین تر همپوشانی کمتر مد اصلی با لایه های با آرایش بالای غلاف و موجبر است.

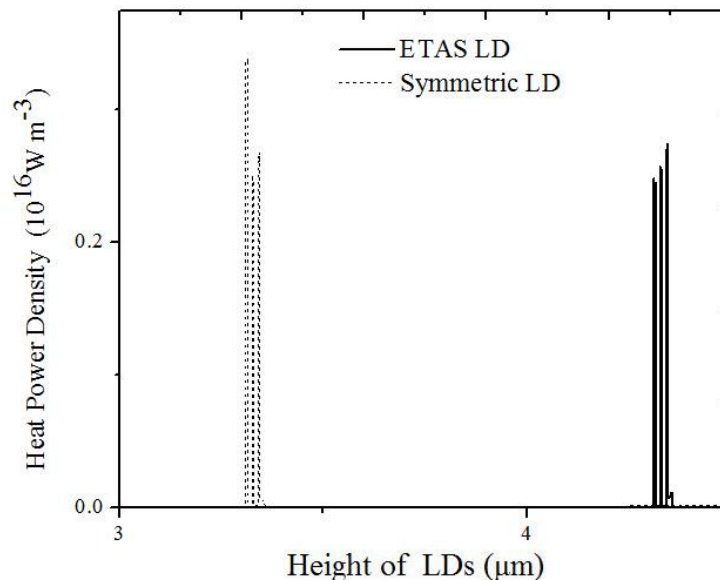


شکل ۹. نمودارهای دمایی محاسبه شده بر حسب ارتفاع برای ساختارهای متقارن و ETAS در جریان تزریقی ۲۰۰ mA و دمای زمینه ۲۰°C

برای کنترل خود گرمایش^۱ لیزر، حرارت تولید شده در لیزر باید بصورت کارآمدی انتقال داده شود. گرمای تولید شده در ناحیه ی فعال با جذب حامل آزاد یا باز ترکیب غیر تابشی ممکن است بهره، بازده شیب و توان خروجی را کاهش داده و

¹ Self- Heating

عملکرد لیزر را تخریب کند. به همین دلیل، کنترل حرارت در بهبود عملکرد لیزر بسیار مهم است. مقاومت حرارتی پایین به این معناست که لیزر می‌تواند گرمای تولید شده را بصورت کارآمدتری انتقال دهد و افزایش دما در ناحیه‌ی فعال کمتر خواهد بود [۱۸].



شکل ۱۰. چگالی توان حرارتی بر حسب ارتفاع برای ساختارهای متقارن و ETAS در جریان تزریقی ۲۰۰ mA و دمای زمینه ۲۰°C

شکل ۱۰ چگالی توان حرارتی را در دستگاه‌ها در جریان تزریقی ۲۰۰ mA و دمای زمینه ۲۰°C نشان می‌دهد. همانطور که در این شکل نشان داده شده است، توان حرارتی تولیدی در ناحیه‌ی فعال لیزر دیود ETAS کمی کمتر از لیزر دیود متقارن است. به همین دلیل، دمای ساختار نامتقارن افزایش کمتری می‌یابد. نتایج و دلایل به دست آمده از این مطالعه، تطابق مناسبی با نمونه‌های ساخته شده‌ی موجود در مراجع [۱۹ و ۲۰] دارد.

نتیجه‌گیری

به‌طور خلاصه، برای اولین بار، موجبر متقارن سه‌گانه‌ی اکستریم معرفی و در دیود لیزری قرمز مبنی بر InGaAlP بکار گرفته شده است. در ساختار موجبر پیشنهادی ETAS جدید، در گام نخست، ضخامت لایه‌های موجبر نوع n و غلاف نوع n افزایش داده شد و سپس تقارن سه‌گانه در طراحی لایه‌های موجبر و غلاف نوع n و نوع p در ساختار موجبر لیزر در نظر گرفته شد. عملکرد ساختارهای لیزر مرسوم و پیشنهادی جدید از نظر تئوری با استفاده از نرم افزار PICS3D مطالعه شد. این نرم افزار شبیه‌سازی‌های سه بعدی انتقال حامل، موجبری نوری و خودگرمايشی را به صورت خودسازگار ترکیب می‌کند. نتایج شبیه سازی نشان دادند که عملکرد ساختار پیشنهادی در مقایسه با ساختار متقارن مرسوم تا حد زیادی بهبود یافته است. لیزر نیمه رسانا با ساختار جدید نامتقارن سه‌گانه‌ی اکستریم دارای

جریان آستانه و مقاومت سری کاهش یافته، توان خروجی و بازده شیب افزایش یافته و پایداری حرارتی بهبود یافته است. که تمام این خصوصیات در عملکرد توان بالا اهمیت بسزایی دارند.

تشکر و قدردانی

تشکر ویژه‌ی خود را نثار مدیران شرکت Cross Light می‌کنم که برنامه‌ی شبیه‌سازی پیشرفته‌ی PICS3D (نسخه ۲۰۰۸، ۱۲) را به صورت آنلاین در اختیار دانشگاه گیلان قرار دادند.

منابع

1. Frevert C., "Optimization of broad-area GaAs diode lasers for high powers and high efficiencies in the temperature range 200-220 K", Doctoral thesis (2018).
2. Hiroshima R., Inoue D., Kameyama S., Tajiri A., Shono M., Sawada M., Ibarak A., "High-Power 200mW 660nm InGaAlP Laser Diodes with Low Operating Current", Jpn. J. Appl. Phys., 43, No. 4B (2004) 1951- 1955.
3. Ryvkina B. S., Avrutinb E. A., "Asymmetric, nonbroadened large optical cavity waveguide structures for high-power long-wavelength semiconductor lasers", J. Appl. Phys., 97, (2005) 123103 .
4. Buda M., Roer van de T. G., Kaufmann L. M. F., Iordache Gh., Cengher D., Diaconescu D., Petrescu-Prahova I. B., Haverkort J. E. M., Van der Vleuten W., Wolter J. H., "Analysis of 6-nm AlGaAs SQW low-confinement laser structures for very high-power operation", IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron, 3, (1997) 173-179.
5. Ryvkina B. S., Avrutinb E. A., "Improvement of differential quantum efficiency and power output by waveguide asymmetry in separate-confinement-structure diode lasers", IEE Proceedings - Optoelectronics, 151, (2004) 232-236.
6. Crump P., Erbert G., Wenzel H., Frevert C., Schultz C. M., Hasler K. H., StaskeR., Sumpf B., Maaßdrof A., Bugge F., Knigee, S., Trankle G., "Efficient High-Power Laser Diodes", IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron, 19 (2013) 1501211-1501211.
7. Edwards Rees P., "Characterisation of the waveguide dependence of optical mode loss in semiconductor lasers", Doctoral thesis, Cardiff University (2017).

8. Koziol Z., Matyukhin S. I., "The effects of multiply quantum wells (MQW) on optical and electrical characteristics of AlGaAs lasers with separate confinement heterostructures (SCH)", <https://www.researchgate.net/publication/51934551> (2011).
9. Available online at www.crosslight.com.
10. Xia M., Ghafouri Shiraz H., "Analysis of carrier heating effects in quantum well semiconductor optical amplifiers considering holes' Non-parabolic density of states", *Optic. Quantum Electron.* 47 (2015) 1847-1858.
11. Hsieh D. H., Tzou A. J., Kao T. S., Lai F. I., Lin D. W., Lin B. C., Lu T. C., Lai W. C., Chen C. H., Kuo H. C., "Improved carrier injection in GaN-based VCSEL via AlGaN/GaN multiple quantum barrier electron blocking layer", *Optic. Express*, 23 (2015) 27145.
12. Piprek J., "Semiconductor Optoelectronic Devices: Introduction to Physics and Simulation", Academic Press San Diego, (2003).
13. Martin O. J. F., Bona G.-L., Wolf P., "Thermal Behavior of Visible AlGaInP-GaInP Ridge Laser Diodes", *IEEE J. Quantum Electron*, 11, (1992) 2582-2588.
14. Dumitrescu M., Toivonen M., Savolainen P., Orsila S., Pess M.a, "High-power edge emitting red laser diode optimisation using optical simulation", *Opt. Quantum Electron*, 31 (1999) 1009-1030.
15. Hiroyama, R., Inoue, D., Kameyama, S., Tajiri, A., Shono, M., Sawada, M., Ibaraki, A., "High-Power 200mW 660nm AlGaInP Laser Diodes with Low Operating Current", *Jpn. J. Appl. Phys*, 43, (2004)1951–1955.
16. H. Sumitomo, S. Kajiyama, H. Oguri, T. Sakashita, K. Nakao, Y. Yamamoto, T. Kita, T. Komatani, H. Kawakubo, M. Ono, and S. Izumi, "High-Power Short-Cavity AlGaInP Laser Diodes", *Technical Review*, 70, (2010) 79-83.
17. Xiang L., Degang Z., Desheng ., Ping C., Zongshun L., Jianjun Z., "Suppression of electron leakage in 808 nm laser diodes with asymmetric waveguide layer ", *J. Semicond.*, 37 (2016) 014007.
18. Zhang Y., "Self-heating control of edge emitting and vertical cavity surface emitting lasers", *Doctoral Dissertation, University of Central Florida*, (2014).

19. Hallman L. W. , Ryvkin B. S. , Avrutin E. A. , Aho A. T. , Jukka V. , Juhat M. G. , Kostamovaara T. , "High Power 1.5 μ m Pulsed Laser Diode with Asymmetric Waveguide and Active Layer Near p-cladding", IEEE Photon. Tech. Let.: 31, (2019) 1635-1638.
20. Kaul T., Erbert G., Maaßdorf A., Martin D. , Crump P., "Extreme triple asymmetric (ETAS) epitaxial designs for increased efficiency at high powers in 9xx-nm diode lasers", Conference: High-Power Diode Laser Technology XVI (2018).

Optimization of AlGaInP-based semiconductor laser performance by introducing extreme triple asymmetric waveguide structure

Zahra Danesh Kafroudi

Department of Engineering sciences, Faculty of Technology and Engineering East of
.Guilan, Unversity of Guilan, Rudasr, Vajargah, Iran

Abstract

In this paper, for the first time, improved lasing performance of a red AlGaInP laser diode is demonstrated by introducing a new extreme triple asymmetric waveguide structure. In the new proposed waveguide structure, at the first step, n-waveguide and n- cladding layer thicknesses are increased and then, a triple asymmetry is introduced on the design of the n-type and p-type cladding and waveguide layers inside the red laser diode structure. The conventional symmetric and the new extreme triple asymmetric laser structures performances are theoretically investigated using simulation software PICS3D. 3D simulations of carrier transport, optical waveguiding and self-heating are combined self-consistently in the software. Numerical results show that the new proposed structure performance is significantly improved in comparison to the conventional symmetric structure. The reasons of improvements are discussed in this investigation. The simulation results show that the use of the new structure reduces the overlap of the optical mode with of high doping regions. On the other hand, by reducing the electron leakage current, an increase in the stimulated recombination rate occurs, which leads to a decrease in the threshold current and an increase in the output power. By reducing the series resistance and increasing the thermal stability of the new proposed structure, the optimality of this structure is confirmed.

Keywords: AlGaInP- based laser diode, Simulation, Power, Threshold current, Extreme triple asymmetric waveguide, PICS3D.